# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Problem Image Mailbox.

# (12) 公開特許公報(A)

#### (11)特許出職公開 号

### 特開平10-96082

(43)公開日 平成10年(1998) 4月14日

(51) Int.Cl. • C 2 3 C 16/44 識別記号

FΙ C 2 3 C 16/44

Z

HO1L 21/205

H01L 21/205

21/3065

21/302

В

### 審査請求 未請求 請求項の数32 FD (全 13 頁)

(21)出願番号

特額平9-171106

(22)出顧日

平成9年(1997)6月12日

(31)優先権主張番号 08/664948

(32)優先日

1996年6月14日

(33)優先権主張国

\*国(US)

(71)出顧人 390040660

アプライド マテリアルズ インコーポレ

イテッド

APPLIED MATERIALS, I

NCORPORATED

アメリカ合衆国 カリフォルニア州

95054 サンタ クララ パウアーズ ア

ペニュー 3050

(72)発明者 ラヴィ カーマダッティ

アメリカ合衆国, カリフォルニア州,

アセルトン, フェアオークス レーン

89

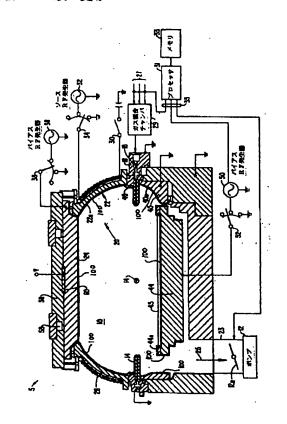
(74)代理人 弁理士 長谷川 芳樹 (5)、4名)

#### (54) 【発明の名称】 基板処理システム構成部材の寿命を延ばす炭素ペース膜の使用

#### (57)【要約】

【課題】 基板処理装置の構成部材の寿命を延ばすため の手段を提供すること。

【解決手段】 本発明は、少なくとも一部が炭素ベース 被膜100で覆われた内面を持つ処理チャンバ10を含 む基板処理装置5を特徴する。炭素ベース被膜は、エッ チングガスと、基板処理中に用いられるほかの反応物質 からチャンバの内面を保護する。この被膜はまた残留物 の蓄積を食い止め、微粒子を発生させず、被覆された材 料内にある不純物を密閉する。好ましい実施形態におい て、炭素ベース被膜はダイヤモンドかダイヤモンド状炭 素(DLC)の被膜のいずれかである。また、本発明 は、基板処理中に用いられる反応物質から処理チャンバ の内面を、その面の少なくとも一部をこうした炭素ペー ス被膜で覆うことにより保護する方法にも及んでいる。



### The Delphion Integrated View

Buy Now: PDF   More choices	Tools: Add to Work File: Create new Work File   \$
View: INPADOC   Jump to: Top   ♣ Go to: Derwer	t Email this to a friend

Title: JP10096082A2: USE OF CARBON-BASED FILM FOR PROLONGING LIFE OF

SUBSTRATE TREATING SYSTEM CONSTITUTING MEMBER

Country: JP Japan

♥Kind: A

\*Inventor: LAVI KARMADATY:

State Applied MATERIALS INC

News, Profiles, Stocks and More about this company

Published / Filed: 1998-04-14 / 1997-06-12

Papplication JP1997000171106

Number:

§IPC Code: C23C 16/44; H01L 21/205; H01L 21/3065;

Priority Number: 1996-06-14 <u>US1996000664948</u>

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a means for prolonging the life of the constituting members of a substrate treating device.

SOLUTION: This substrate treating device 5 includes a treating chamber 10 which has inside surfaces at least partly covered with carbon-based films 100. These carbon-based films protect the inside surfaces of the chamber against etching gases and the other reactive materials used during the substrate treatment. The films also prohibit the accumulation of residues, prevent the generation of particulates and hermetically seal the impurities existing within the coated materials. In a more preferable embodiment, the carbon-based films are films of either of diamond or diamond-like carbon(DLC). This invention also covers a method of protecting the inside surfaces of the treating chamber against the reactive materials used during the substrate treatment by covering at least part of these surfaces with such carbon-based films.

COPYRIGHT: (C)1998, JPO

♥INPADOC

None

Buy Now: Family Legal Status Report

Legal Status:

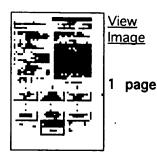
Family:

Show 2 known family members

Other Abstract

CHEMABS 128(25)316149H CAN128(25)316149H DERABS

Info: C98-280633 DERC98-280633



Info: C98